

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 1 月 11 日 (2007.1.11)

【公開番号】特開 2005-322612(P2005-322612A)

【公開日】平成 17 年 11 月 17 日 (2005.11.17)

【年通号数】公開・登録公報 2005-045

【出願番号】特願 2004-244848(P2004-244848)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 11 月 17 日 (2006.11.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

基板上に少なくとも下部電極を形成する前処理工程と、該前処理工程後に前記下部電極上に少なくとも有機発光機能層を有する有機層と上部電極を成膜する成膜工程と、該成膜工程後に前記有機層及び前記上部電極を封止する封止工程とを有する有機 E L 素子の製造方法において、前記前処理工程後から前記上部電極形成前までに検査工程を行い、該検査工程の検査結果に基づいて前記有機層の膜厚調整が行われることを特徴とする有機 E L 素子の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 2】

[請求項 1] 基板上に少なくとも下部電極を形成する前処理工程と、該前処理工程後に前記下部電極上に少なくとも有機発光機能層を有する有機層と上部電極を成膜する成膜工程と、該成膜工程後に前記有機層及び前記上部電極を封止する封止工程とを有する有機 E L 素子の製造方法において、前記前処理工程後から前記上部電極形成前までに検査工程を行い、該検査工程の検査結果に基づいて前記有機層の膜厚調整が行われることを特徴とする有機 E L 素子の製造方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 1】

このように、図 2 (a) , 図 3 に示す有機 E L 素子の製造方法によると、成膜工程 S 2 による真空蒸着装置に搬入する前に下部電極等の膜厚を測定することができる。